

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成23年12月15日(2011.12.15)

【公開番号】特開2010-109118(P2010-109118A)

【公開日】平成22年5月13日(2010.5.13)

【年通号数】公開・登録公報2010-019

【出願番号】特願2008-279146(P2008-279146)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

H 01 L 21/027 (2006.01)

B 08 B 3/02 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 4 3 C

H 01 L 21/30 5 6 9 C

H 01 L 21/304 6 4 3 A

H 01 L 21/304 6 4 5 B

B 08 B 3/02 B

【手続補正書】

【提出日】平成23年10月31日(2011.10.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

回転する基板に対して処理用の液体を供給して前記基板の処理をする基板処理装置であつて、

前記基板の一方の面と前記基板の端面部分に対して前記処理用の液体を供給する物理洗浄ツールと、

前記基板の他方の面に対して保護用の流体を供給して前記基板の他方の面側に前記処理用の液体が回り込むのを防止する回り込み防止用供給ノズルと、
を備え、

前記回り込み防止用供給ノズルは、前記基板の回転方向において少なくとも前記物理洗浄ツールから処理用の液体を吹き付ける基板の一か所の位置に固定されていることを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】

前記回り込み防止用供給ノズルは、前記基板の回転方向において180度反対の位置の2か所に固定されていることを特徴とする請求項1に記載の基板処理装置。

【請求項3】

前記回り込み防止用供給ノズルは、前記基板の前記端面部分に向けて前記保護用の流体を供給する請求項1または請求項2に記載の基板処理装置。

【請求項4】

前記物理洗浄ツールは、前記処理用の液体を供給する内筒と、前記処理用の液体を霧化するために気体を供給する外筒と、を有する2流体ノズルであることを特徴とする請求項1～請求項3のいずれか1つの項に記載の基板処理装置。

【請求項5】

前記物理洗浄ツールは、蒸気を供給することを特徴とする請求項1に記載の基板処理装

置。

【請求項 6】

前記保護用流体は、不活性ガスであることを特徴とする請求項 1 ~ 請求項 5 のいずれか 1 つの項に記載の基板処理装置。

【請求項 7】

前記保護用流体は、ドライエアであることを特徴とする請求項 1 ~ 請求項 5 のいずれか 1 つの項に記載の基板処理装置。

【請求項 8】

回転する基板に対して処理用の液体を供給して前記基板の処理をする基板処理方法であつて、

物理洗浄ツールは、前記基板の一方の面と前記基板の端面部分に対して前記処理用の液体を供給し、

回り込み防止用供給ノズルは、前記基板の回転方向において少なくとも前記物理洗浄ツールから処理用の液体を吹き付ける基板の一か所の位置に固定されており、前記基板の他方の面に対して保護用流体を供給することを特徴とする基板処理方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 3】

